

## **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

04236416

**PUBLICATION DATE** 

25-08-92

APPLICATION DATE

18-01-91

**APPLICATION NUMBER** 

03019289

APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR: TONALKEIICHIRO;

INT.CL.

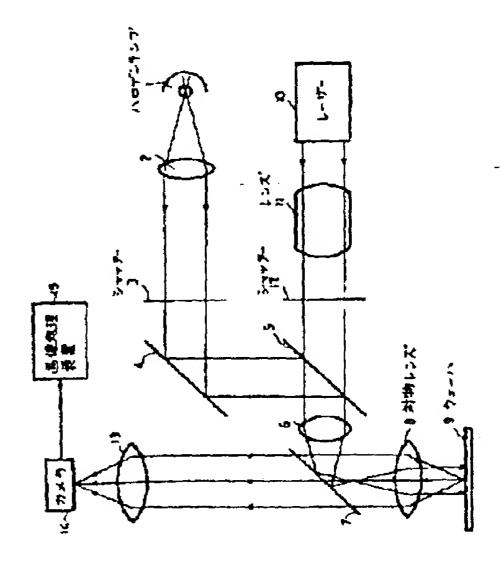
: H01L 21/00

TITLE

: ALIGNMENT ERROR ANALYZING

**EQUIPMENT FOR SEMICONDUCTOR** 

**DEVICE** 



ABSTRACT: PURPOSE: To analyze alignment error from optical characteristics of an alignment mark.

CONSTITUTION: A white light source 1 and a laser light source 10 are used as light sources. By an image processing equipment 15, the image signal of an alignment mark is detected with the same optical system. By filtering the image signal with the laser light, an image signal of a specified diffraction light is obtained. The image signals of the respective cases are compared with the center positions of the alignment mark detected by the image signals.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-236416

(43)公開日 平成4年(1992)8月25日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H 0 1 L 21/00

J 8518-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-19289

平成3年(1991)1月18日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 東内 圭一郎

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

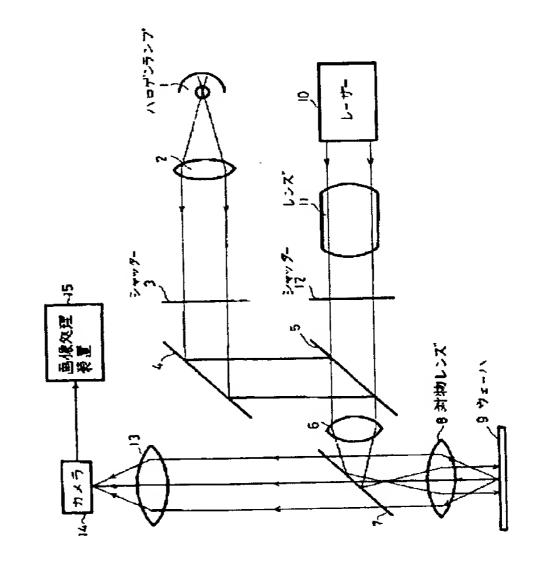
(74)代理人 弁理士 井出 直孝

## (54)【発明の名称】 半導体装置のアライメント誤差解析装置

## (57)【要約】

アライメントマークの光学特性からアライメ 【目的】 ント誤差を解析できるようにする。

光源として白色光源1とレーザー光源10の二 【構成】 光源を用い、画像処理装置15により、アライメントマー クの画像信号を同一の光学系で検出し、また、レーザー 光で画像信号をフィルタリングすることにより特定回折 光の画像信号を得、それぞれの場合の画像信号とそれに より検出されたアライメントマークの中心位置とを比較 する。



てのレーザー10の二つから構成され、ハロゲンランプ1 とレーザー10を切り換える切換手段としてのシャッター 3 およひ12と、イメージセンサ15a 、フレームメモリ15 b 、検出された反射光を画像信号に変換し、この変換さ れた画像信号から前記アライメントマークの第一の中心 位置およびビッチ寸法を求める位置寸法算出手段15c 、 レーザー光について求めれらたビッチ寸法の整数倍の範 囲の画像信号をフーリエ変換し特定の空間周波数を選択 し逆フーリエ変換しフィルタリングされた画像信号を得 その位相より前記アライメントマークの第二の中心位置 10 を求めるフィルタリング手段15d 、ならびに白色光とレ ーザ光による画像信号および前記アライメントマークの 第一の中心位置と第二の中心位置の比較を行う比較手段 15e を含む画像処理装置15とを備えている。

【0013】次に、本実施例の動作について説明する。 【0014】ハロゲンランプ1による白色光は、レンズ 2、反射鏡4、半透過鏡5、レンズ6、半透過鏡7、お よび対物レンズ8を通して、ウェーハ9上に照明され る。また、レーザー10からの単色光は、レンズ11および 半透過鏡5を通った後、白色光と同一光路によりウェー 20 ハ9上に照明される。各光源はそれぞれシャッター3お よびシャッター12により切り換え選択される。

【0015】ウェーハ9上のアライメントマークからの 反射光は、対物レンズ8、半透過鏡7およびカメラレン ズ13を通り、カメラ14の受光面上に拡大像として結像さ れる。カメラ14により拡大像は画像信号として検出さ れ、画像信号は画像処理装置15に入力される。

\*【0016】画像処理装置15により信号処理手順の一例 を図るに示す流れ図により説明する。

【0017】 二次元のイメージセンサ15a により検山さ れた反射光は画像信号f(x,y)に変換される(ステ ップS1)。そして、画像信号f(x,y)は、一旦フ レームメモリ15b 上に記憶し(ステップS2)、この両 像信号から位置寸法算出手段15c により、スレッショル ド法により回折格子からなるアライメントマークの各格 子のエッジ位置を検出し(ステップS3)、さらに、各 格子のエッジ位置より、格子のピッチ寸法2L、および 回折格子の中心位置を算出する(ステップS4)。

【0018】次に、フィルタリング手段15d により、画 像信号f(x, y)の一走査線y。上の信号g(x)か ら、フーリエ係数 a. 、b. を数1により算出する。

[0019]

【数1】

$$a_{n} = \frac{\Delta x_{n}}{1 L^{k_{n}-n}} g (m\Delta n) \cos \left(\frac{n \pi}{L} \cdot m\Delta x\right)$$

$$b_n = \frac{\Delta x_m}{1 L^{ks-m}} g (m \Delta n) \sin \left[ \frac{n \pi}{L} \cdot m \Delta x \right]$$

ただし、 Axは画素間距離、1、m、nは整数

【0020】これから、n次の高周波成分のみをフィル タリングした信号 I. (x)を数2より算出する。

[0021]

【数2】

$$I_n(x) = r_{-n}^2 + r_n^2 + r_{-n}r_n \cos \left\{ \frac{2n\pi}{L} x - (\theta_1 - \theta_2) \right\}$$

$$total_n r_{\pm n} = \sqrt{a^2 \pm n + b^2 \pm n}$$

$$\theta_{\pm n} = \tan^{-1} \left( \frac{-b_{\pm n}}{a_{\pm n}} \right)$$

これより、アライメントマークの中心位置 x 。を数3よ り求める(ステップS5)。

[0022]

【数3】

$$x_0 = \frac{L}{2n\pi} (\theta_1 - \theta_2)$$

【0023】レーザー光より得られる画像のn次高周波 をフィルリングした画像信号は、回折格子からn次回折 光のみを検出して得られる画像信号に相当し、これから 得られるアライメントマーク中心位置は、n次回折光を 検出して得たアライメントマスクの中心位置に相当す る。

【0024】以上のようにして、白色光から得られた画 像信号、およびアライメントマークの中心位置と、レー ザー光からフィルタリングし、得られた画像信号および 50 フィルタリングすることにより特定回折光の画像信号を

アライメントマークの中心位置との関係は、白色光によ る重ね合わせ精度の測定値と、アライメントシステムで のアライメント位置との関係に相当し、これより、測定 したアライメントマークにより発生するアライメントの 誤差を解析する(ステップS6)。

40 【0025】なお、この場合、画像処理手順内のマーク エッジ位置検出方法として、最大傾斜法等のアルゴリズ ムを使用する方法や、マークピッチ寸法の算出に、画像 をx方向に平行移動し、元の画像との誤差が最小二乗法 で極小となる位置から求める方法を用いることもでき

[0026]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、白色光 とレーザー光によるアライメントマークの画像信号を同 一の光学系で検出し、また、レーザー光での画像信号を

